DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. 004499890 WPI Acc No: 1986-003234/ 198601 XRAM Acc No: C86-001373 XRPX Acc No: N86-002267 Two component diazo copying material - comprises precoating layer, photosensitive layer contg. diazo cpd. and a coupler Patent Assignee: RICOH KK (RICO ) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002 Patent Family: Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 60229027 A 19851114 JP 8484158 Α 19840427 198601 B JP 93044659 В 19930707 JP 8484158 Α 19840427 199330 Priority Applications (No Type Date): JP 8484158 A 19840427 Patent Details: Patent No Kind Lan Pq Main IPC Filing Notes JP 60229027 Α JP 93044659 R 4 G03C-001/79 Based on patent JP 60229027 Abstract (Basic): JP 60229027 A Copying material with precoating layer, and photosensitive layer has diazo cpd. and coupler as main ingredients, on a base, wherein the precoating layer includes at least one kind of resin e.g. inter polymer of vinyl chloride and acrylic ester with less than 4C at the ester portion. USE/ADVANTAGE - Image density is improved and dirt is prevented using dry development. Title Terms: TWO; COMPONENT; DIAZO; COPY; MATERIAL; COMPRISE; PRECOAT; LAYER; PHOTOSENSITISER; LAYER; CONTAIN; DIAZO; COMPOUND; COUPLE Derwent Class: A14; A89; E24; G06; P83 International Patent Class (Main): G03C-001/79 International Patent Class (Additional): G03C-001/52; G03C-001/76 File Segment: CPI; EngPI Manual Codes (CPI/A-N): A04-E03; A04-F06E4; A12-L01; E10-E02D; E21-E; E26-A01; G06-A; G06-F02 Plasdoc Codes (KS): 0209 0218 0231 0495 3006 3020 0537 0544 0579 0593 0761 2718 2809 Polymer Fragment Codes (PF): \*001\* 014 034 04- 040 061 062 063 074 076 081 082 083 084 27& 477 63& 658 729 Chemical Fragment Codes (M3): \*02\* G012 G016 G022 G100 G221 H4 H402 H403 H442 H443 H8 M280 M320 M414 M510 M520 M531 M540 M782 M903 Q130 Q311 Q346 R043 Chemical Fragment Codes (M4): \*01\* G013 H1 H103 H141 K0 K5 K533 L7 L722 M210 M211 M212 M213 M231 M232 M273 M282 M320 M414 M510 M520 M531 M540 M640 M782 M903 Q130 Q344 Q346 R043 W003 W030 W041 W131 \*03\* G012 G016 G022 G100 G221 H4 H402 H403 H442 H443 H8 M280 M320 M414 M510 M520 M531 M540 M782 M903 Q130 Q311 Q346 R043 W003 W030 W122 Derwent Registry Numbers: 0851-U; 0856-U

## ⑲ 日本園特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭60-229027

@Int\_Cl\_4

識別記号

广内猝理番号

43公開 昭和60年(1985)11月14日

G 03 C 1/76 1/52 8205-2H 8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

二成分型ジアゾ複写材料

頭 昭59-84158 ②特

頣 昭59(1984) 4月27日 ❷出

⑦発 明 者 栗 徳 夫

茂

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

平 砂発 明 者

猛 男 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

明 ⑦発

强 匂 呂

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー 頭 人 创出 弁理士 月 村 00代 理 人

栖

林

外1名

発明の名称

二成分型ジアソ被写材料

- 特許謝求の範囲
  - とカップラーを主成分とする感光円を設けた 二成分型ジアソ複写材料において、眩プレコ ート胎に、エステル部の炭器数が4以上の塩 化ピニル-アクリル設エステル共復合体の中 から選ばれた樹脂の少なくとも一祖を含有せ しめたことを特徴とする二成分型ジアグ復写 材料。
- 3. 発明の詳細な説明

### 技術 分野

本発明は二成分型ジアソ複写材料に関する。 従来技術

二成分型ジアソ選写材料として、支持体上に プレコート府を介して感光府を設けたものが知 的で散けられており、従来よりプレコート胎に、 多孔質均料とでんぶんのような水溶性樹脂を使 用することや、ポリスチレンのような合成樹脂 を 使用することが知られている。しかし、前者 は水溶性であるため盆布液の増粘化が起り使用 **且が限定されるといつた欠点を有し、また後者** は松度向上の寄与率が小さいといつた欠点を有

また、プレコート樹脂として酢酸ビニルやア クリル酸エステルを使用することも知られてい るが、これらの樹脂をプレコート樹脂として使 用した被写材料を乾式現做した際には現像汚れ が大きく乾式ジアソ彼写材料には適用困難であ つた。

### 目 的

本発明の目的は、プレコート層に適切な樹脂 を用いることによつて、画像数度を向上させ、 さらに乾式現像の際の現像汚れを解消すること にある。

引。 "你只是你是我们的解释的看到这个概念的是你的一样也。"

本発明は支持体上にプレコート層及びジアゾ

化合物とカップラーを主成分とする感光局を設けた二成分型ジアソ複写材料において、酸プレコート 門に、エステル部の炭素数が 4 以上の塩化ビニル・アクリル酸エステル共 重合体の中から選ばれた樹脂の少なくとも一種を含有せしめたことを特徴とするものである。

はできない。 炭素数 4 以上のエステルとしては、 プチル、オクチル、ラウリル、ステ丁リル、ド デシル等が挙げられる。

また、プレコート脳には、多孔質の填料を併用するとよい。填料としてはシリカ徴粒子、スターチ、クレー、アルミナ、炭酸カルシウム、尿素・ホルマリン樹脂徴粒子、スチレン樹脂徴粒子等の有機又は無機フィラーが挙げられる。なお、本発明の目的を疎外しない範囲で他の樹脂をプレコート胎に混合することは防げず、また他の第三、第四成分等を含有させてもよい。

感光間はジアゾ化合物及びカップラーを主成分とするが、ジアゾ化合物及びカップラーとしては、従来より二成分型ジアゾ被写材料の分野で使用されているものがそのまま適応できる。

従つて、シアソ化合物としては例えば、4 -シアソー1 - ジメチルアミノペンゼン、4 - ジ アソー1 - ジエチルアミノペンゼン、4 - ジア ソー1 - ジプロピルアミノペンゼン、4 - ジア ソー1 - メチルペンジルアミノペンゼン、4 -

ジアソ-1-シペンジルアミノペンセン、4-ジアソ-1-エチルヒドロキシエチルアミノベ ンセン、4-ジアゾ-1-ジエチルアミノ-3 ーメトキシペンゼン、ィージアゾー1-ジメチ ルアミノー2-メチルペンゼン、4~ジアゾー 1-ペンゾイルアミノー2,5-ジエトキシベー ンセン、4-シアゾ-1-モルホリノベンゼン、 4-ジアゾー1-モルホリノー2,5-ジエト キシペンセン、4-ジアゾ-1-モルホリノー 2 , 5 - ジプトキシベンゼン、4 - ジアゾー1 - アニリノベンゼン、4~ジアゾ・1~ジメチ ルアミノー3 - カルポキシベンゼン、4 - ジア ソー1-トルイルメルカプト-2,5-ジエト キシベンセン、4 - ジアゾ・1 , 4 - メトキシ ペンソイルアミノ - 2 , 5 - ジエトキシベンゼ ンなどのジアゾ化合物と塩化物の金属ハイライ ド(塩化亜鉛、塩化カドミウム、塩化盤など) との被塩及び、前配ジアゾ化合物の硫酸、四弗 化硼器、ヘキサフルオロ燐酸などの強酸の塩な どがあげられるが、勿論これらに限定されるも

のではない。

カップラーとしては例えば、レゾルシン、フ ロログルシン、2,5-ジメチル-4-モルホ リノメチルフエノール、3-ヒドロキシシアノ アセトアニリド、p-スルホアセトアニリド、 1 - ペンゾイルアミノ - 8 - ヒドロキシナフタ レン-3,6-ジスルホンアミド、2,3-ジ ヒドロキシナフタレン、2,1-ジヒドロキシ ナフタレン-3,6-ジスルホン酸ソーダ、2. 3 - ジヒドロキシナフタレン - 6 - スルホン酸 ソーダ、2,5-ジヒドロキシナフタレン-6 - スルホン酸ソーダ、1-ヒドロキシナフタレ ン・4~スルホン酸ソーダ、1~アミノ-3~ ヒドロキシナフタレン・3 , 6 - ジスルホンア ミド、ナフトールAS、ナフトールAS-D、2 - ヒドロキシナフタレン - 3 - ピグアナイド、 2 - ヒドロキシナフトエ酸モルホリノプロピル アミド、2~ヒドロキシナフトエ酸エタノール アミド、2-ヒドロキシナフトエ酸 - N - ジメ チルアミノプロピルアミド塩酸塩、 2,2',4,

4'-テトラヒドロキンジフエニル、2,2',4, 4'-テトラヒドロキンジフエニルスルホキンド などがあげられるが、勿陰これらに限定される ものでない。

本発明では以上の繋材の他に、通常ジアゾ復 写材料に用いられている各種の添加剤を用いる ことができる。例えば現飲促進剤としてエチレ ングリコール、トリエチレングリコールなど; 保存性向上剤としてナフタレン-モノスルホン 俊ナトリウム、ナフタレン ~ ジスルホン酸ナト リウム、ナフタレンートリスルホン餃ナトリウ ム、スルホサリチル酸、硫酸カドミウム、硫酸 マクネシウム、塩化カドミウム、塩化亜鉛など ; 酸化防止剤としてチオ尿素、尿素など; 溶解 剤としてカフェイン、テオフイリンなど;酸安 定剤としてクエン酸、酒石酸、硫酸、乙酸、硼 酸、燐酸、ピロ燐酸などが適宜配合されてよく、 その他にもサポニンを少性添加することができ る。また画像政度向上剤として、感光后にもシ スターチ、クレー、樹脂等の無极有機像

粒子が適当登録加されていても良い。

本発明のジアソ被写材料を作製するには、紙、フィルム等の支持体上に、まず主に前配の樹脂と必要に応じて多孔質の填料、その他の添加剤を添加した塗布液を通常の塗布法により塗布乾燥して0.18/1~58/14のプレコート后を設け、さらにその上にジアソ化合物、カップリング成分、必要に応じて多孔質の填料及びその他の助剤より成る塗布液を塗布乾燥して感光后を設ければ良い。

### 効 果

本発明によれば、プレコート層にエステル部の炭素数がも以上の塩化ビニル・アクリル酸エステル共連合体樹脂を使用するため、画像濃度が向上される上、乾式現像の際の現像汚れも解消される。

以下、実施例により本発明の効果を具体的に示す。

### 突施例1

塩化ピニル - アクリル段オクチル 共恵合樹脂 (50%エマルジョン)

6 8

シリカ微粒子

5 ₽

水

1008

より成る盗布液をジアソ後写紙用原紙の表面に 盗布乾燥して 18/dのプレコート 搭を設けた。 さらにその上に

pージメチルアミノベンセンジアソニワム クロライド・MZnC8:		0.	5 9	,
2,3-ジヒドロキシナフタレン - 6 - スルホン散ソーダ			28	!
クエン酸			2 8	,
塩 化 亜 鉛			5 8	J
チオ尿袋			5 9	,
エチレングリコール			5 8	!
水	1	0	0 9	,

より成る盗布被を盗布乾燥して約18/mの服光 門を形成しジアゾ被写材料(サンプルA)を得た。

一方、比較の為に、プレコート眉を除去し、 かわりにサンブルAの感光液の中に、サンプル Aのプレコート的のシリカ数粒子と同性のシリ カ徴粒子を加えた他は同様にしてジアソ復写材料を得た(サンプルB)。また、サンプルB)のまた、サンプルBとピールーアクリル酸オイイン・一下の塩化ピールークリルのカヤでで、サンプル Aのかれた。 で、サンプル C)のはで、サンプル C)のはで、サンプル C)のはで、サンプル C)のはで、カウに同性では、かけにしてジアノル B)を得たしてジアソ復写材料(サンプル C)に同様にしてジアソ復写材料(サンプル C)を得た。

以上のようにして得られた各サンプルを乾式シアソ被写機(リコー製 8 M-1500) を用いて現像した後、フォトポルト微度計を用いて画像改度を測定した。また乾式現像の際の現份汚れは、前記の復写機で各サンプルを 5 m/mの選度で5000 枚現像を行つた後 6000 枚目の

各サンプルのキメ汚れの有無、及び現像部内の 汚れの有無で判断した。結果を装~1 に示す。

表 - 1

		/	画像设度	サングルのキメ、汚れ	現像部内の汚れ
サンプノ	va Va		1.30	認められず	認められず
,	В	比较例	1. 1 0	汚れ有り	付滑物有り
,	С	,	1. 2 0	秋、汚れとも大	付船物大
,	D	,	1. 2 1	, , ,	,
,,	E	"	1. 2 9	認められず	わずかに付着物 有り

表-1 に示した通り本発明は凝度が高くかつ 乾式現像の際の現像汚れは認められないことが 分る。

### **契施例 2**

塩化ピニル-アクリル酸プチル共風台物 (508エマルション)			6	8
尿素・ホルマリン樹脂微粒子			3	з
<b>*</b>	1	0	0	8

より成る盤布液をシアソ被写紙用原紙の表面に

は同様にしてジアソ彼写材料を得た(サンプルG)。サンプルGの画像改度はサンプルEよりも 0.15低く、かつ現像汚れも大きかつた。

## **奥施例** 3

塩化ピニル - アクリル酸オクチル 共重合樹脂(50多エマルジョン)	5 <i>9</i>
スチレン樹脂微粒子	2 8
. بند	1008

より成る塗布液をシアソ復写紙用原紙の装面に 塗布乾燥して 0.68/mのプレコート層を設けた。 その上に更にサンプルドの感光液の中に、スチ レン樹脂微粒子を 28 加えた他は同様にして感 光脳を設け被写材料を得た(サンプルH)。 得られたサンプルを実施例 1 と同様に現像した ところ高濃度画像が得られた。また現像汚れも なかつた。



2,5-ジエトキシー4ーモルホリノベンゼン ジアゾニウムクロライド・½ Z n Cl:	2 8
2-ヒトロキシ-3-ナフトエ酸 モルホリノプロピルアミト	2 5 8
塩化 進 鉛	1. 5 🛭
チオ尿紫	1. 5 8
酒 石 鰕	2 8
トリエチレングリコール	3. 5 8
<b>7</b> k	008

より成る塗布液をジアソ複写紙用原紙の装面に 塗布乾燥して感光浴を設けた。得られたジアソ 複写材料(サンプルF)を実施例1と同様にし て現像を行つたところ、鮮明な高微度青色画像 を待た。また実施例1と同様に現像汚れもなか つた。

一方比較の為にサンプルドの塩化 ピニル・ア クリル酸プチル共重合物を除去し、かわりにポ リアクリル酸樹脂をプレコート層に使用した他